MÜHENDİSLER İÇİN YARIİLETKEN FİZİĞİ FIZ1951

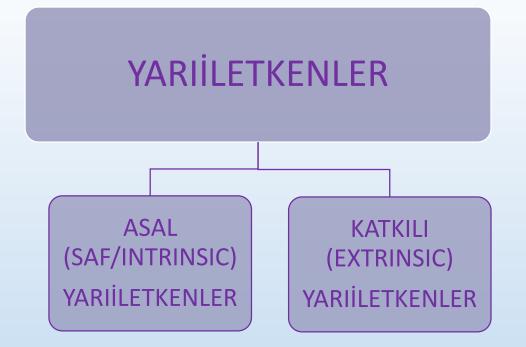
Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuar (saat/hafta)
Mühendisler için Yarıiletken Fiziği	FIZ1951	3	5	3	0	0
Ara Sınavlar	2			60		
Final	1			40		
	TOPLA	ΔM		100		

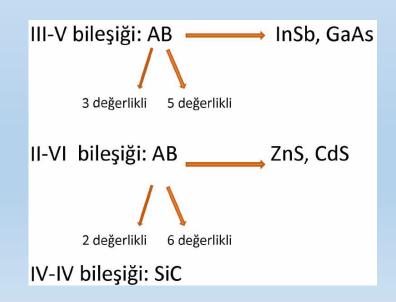
Saf ve Katkılı Yarıiletkenler

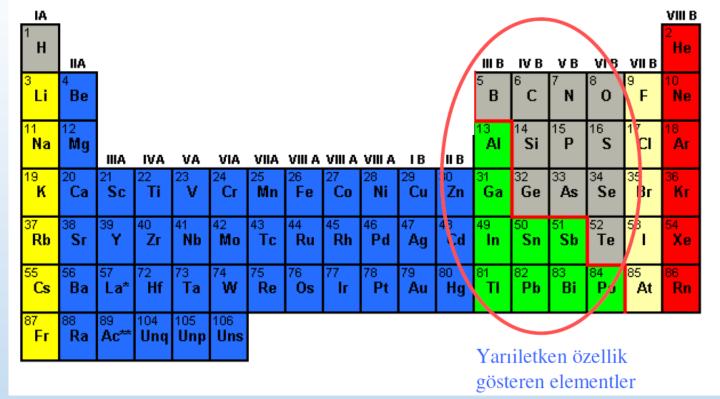
Denge Durumunda Yarıiletkenlerde Taşıyıcı Konsantrasyonu Enerji ve Durum Yoğunluğu

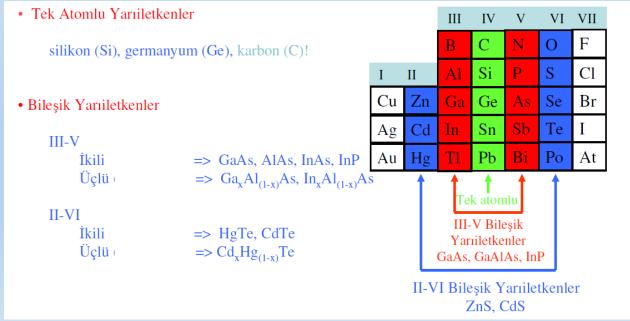
KAYNAKLAR

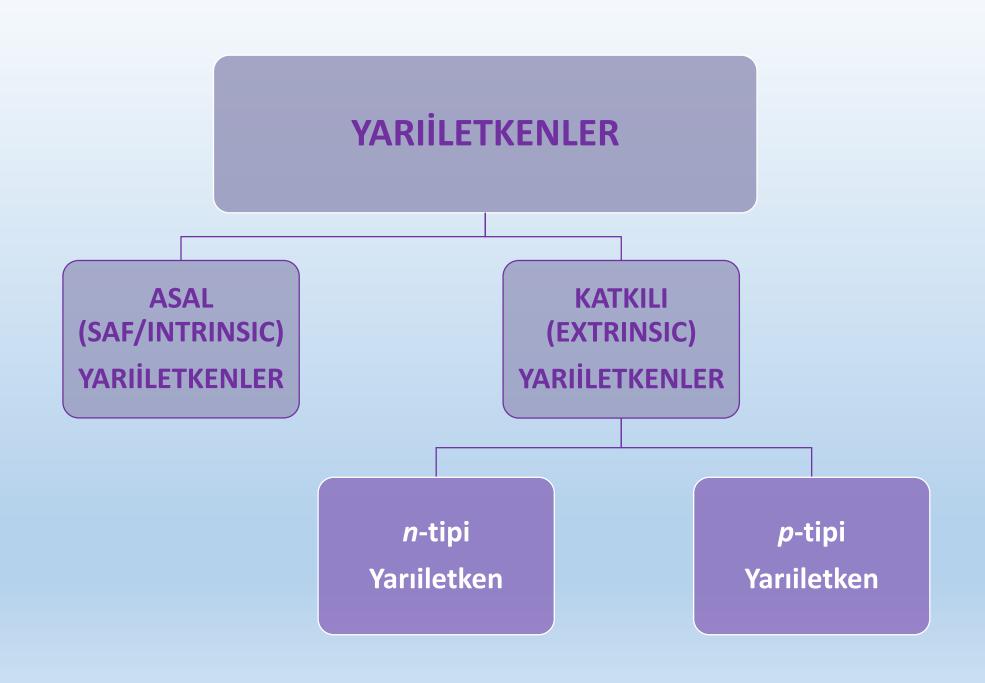
- •Modern Fizik; J.R.Taylor, C.Zafaritos Çev. Prof. Dr. B. Karaoğlu.
- •Fen ve Mühendislik için Fizik R.A.Serway Çev: K.Çolakoğlu, Palme Yayıncılık.
- •Katıların Fiziği Richard Turton; Çeviren: Yahya Kemal Yoğurtçu Aktif Yayınevi; Erzurum, 2005.
- •Yarıiletken Fiziği 1 Prof. Dr. Tayyar Caferov YTÜ Yayınları.
- Katıhal Fiziğine Giriş, Prof. Dr. Mustafa Dikici
- •Katıhal Fiziğine Giriş, Prof. Dr. Tahsin Nuri Durlu, AÜ, 1996
- •Katıhal Fiziği, J.R. HOOK & H.E. Hall, çeviri: F. Köksal, M. Altunbaş, M. Dinçer, E. Başaran, Literatür Yayınları, 1998
- •Katıhal Fiziği Temelleri: Ercüment Akat, Papatya Yayıncılık, 2010.
- •Yarıiletken Fiziği, Donalt Neamen Ceviri Mustafa Sağlam,
- •Optoelektronik TÜBA Açık Ders, H.Sarı,
- •Elementary Solid State Physics: Principles and Applications, M. Ali OMAR, 1974
- •Physics of Semiconductor Devices, S. M. Sze and Kwok K. Ng, 2007 Wiley and Sons.



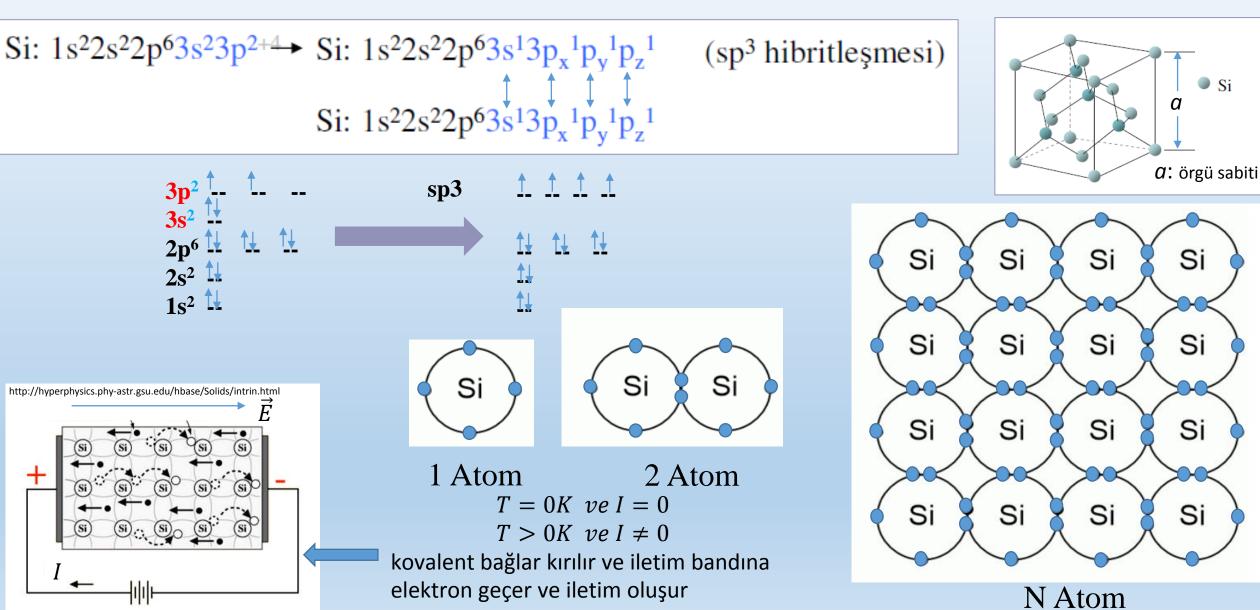






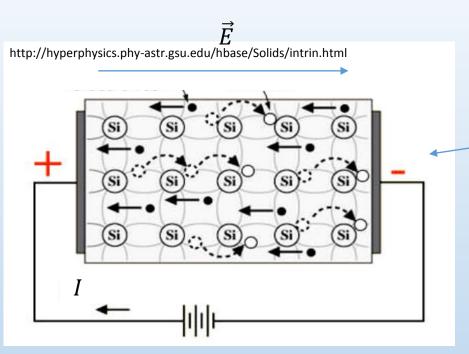


SİLİKON



SILIKON

ASAL/SAF/INTRINSIC (KATKISIZ) YARIİLETKENLER



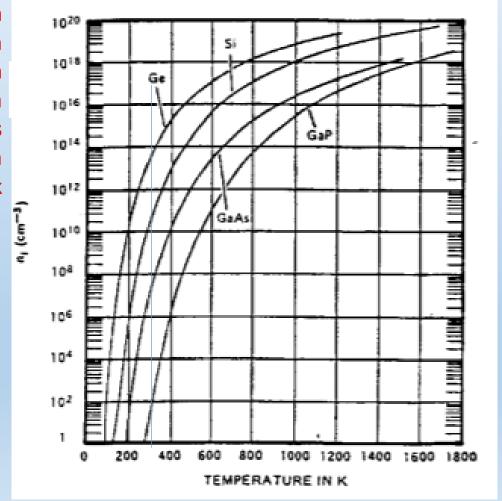
T = 0K ve I = 0 iletim bandında elektron yok

$$T > 0K \text{ ve } I \neq 0$$

Valans bandından iletim bandına bir elektron çıkarabilmek için verilen ısısal enerji ile aslında atomlar arası bir bağ kırılmış demektir. Ve başlangıçta lokalize olan elektron artık serbest hale gelmiştir.

$$n_i = C T^{3/2} e^{-Eg/2kT} \ (m^{-3})$$

Silikon için C = $7.3 \mathrm{x} 10^{15} \mathrm{cm}^{-3} \mathrm{K}^{-3/2}$
 $E_g = 1.12 \ \mathrm{eV}$
 $p_i = n_i \cong 10^{16} (m^{-3}) \ @300 \mathrm{K}$



ELEKTRON VE BOŞLUKLAR:

Başlangıçta tamamen dolu valans bandında bulunan elektronlar ısıl uyarılarak iletim bandına geçmişlerdir.

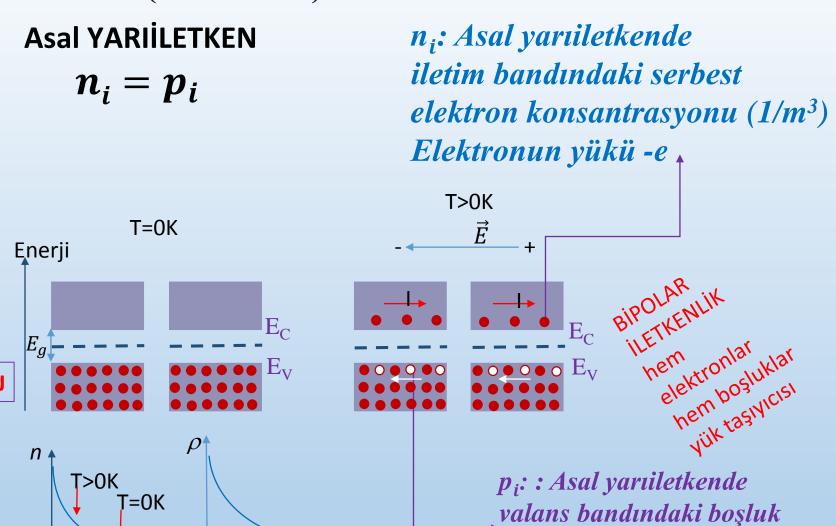
- * İletim bandındaki birim hacimdeki elektron sayısı=Valans bandından ısıl uyarımla ayrılan elektron sayısı
- * Elektrik alan varlığında valans bandında kalan boşluklar yarıiletkende serbest yük taşıyıcılarına ikincil bir katkı sağlar. Bu hareketli yük taşıyıcıları boşluk veya hol adını alır.
- * Valans bandındaki boşluk +e yüklüdür ve elektronun olmama durumu olarak da tanımlanır.
- * +e yüklü boşlukların mobilitesi (μ_p) ile elektronun (μ_n) mobilitesi farklıdır.

$$k_B = 1.38 \mathrm{x} 10^{-23} \, \mathrm{J/K}$$
 , 1eV = 1.6x10-19 J

$$k_BT = 1,38x10^{-23}J/K x 300K$$

= 414x10⁻²³J
= 25,875x10⁻³eV
= 0.026eV
 \cong 26meV

$$C = \frac{2^{5/2} (m\pi k)^{3/2}}{h^3}$$



ρ sıcaklıkla azalıyor.

$$n = CT^{3/2}e^{-E_g/2kT}$$

n sıcaklıkla artıyor

Elektrik alanda elektronun hareket yönü
Elektrik alanda boşluğun hareket yönü

konsantrasyonu (1/m³)

Boşluğun yükü, e dir.

Asal bir yarıiletkende elektriksel iletkenlik hem elektron hem de boşluk denilen iki tip yük taşıyıcısı ile sağlanmaktadır.

Bu duruma *BiPOLAR İLETKENLİK* denir.

$$\sigma_n = ne\mu_n$$
 $\sigma_p = pe\mu_p$
Toplam iletkenlik;

$$\sigma = \sigma_n + \sigma_p$$

$$\sigma = e(p\mu_p + n\mu_n) Bipolar iletkenlik genel if adesi$$

 μ_n : elektronun mobilitesi μ_p : boşluğun mobilitesi

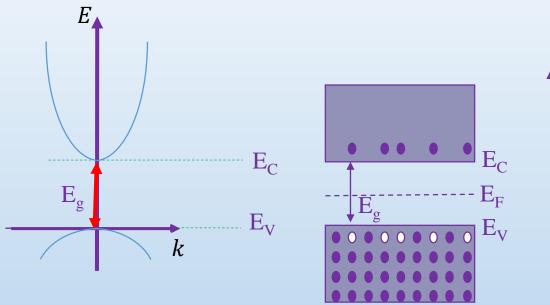
n: iletim bandındaki serbest elektron konsantrasyonu p: valans bandındaki boşluk konsantrasyonu

Elektron

Asal YARIİLETKEN

$$n_i = p_i$$

Kütle etkisi Yasası n_i . $p_i = n_i^2 = p_i^2$



FERMI ENERJISI

 E_C : İletim bandının dibi E_V : Valans bandının tavanı

E: Enerji

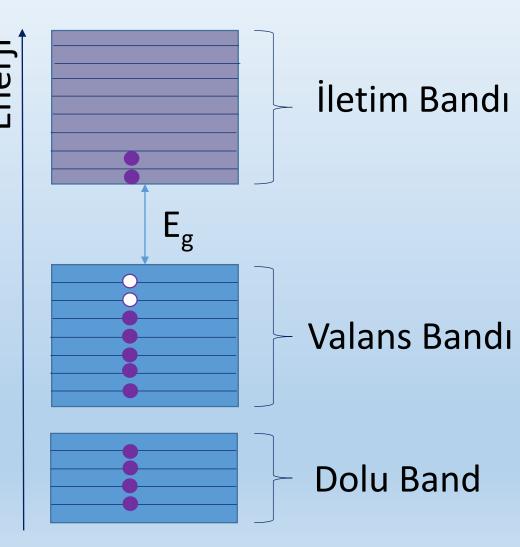
 E_g : Yasak Band Aralığı

 E_F : Fermi Seviyesi

 n_i : Saf yarıiletkende serbest elektron konsantrasyonu (serbest elektron sayısı/m³)

 p_i : Saf yarıiletkende serbest hol (boşluk) konsantrasyonu (serbest hol sayısı/m³)

- Bir kristal elektronu mevcut en düşük enerjili seviyeyi işgal eder. (Min en. olma)
- Kristalin sürekli dengede olması kendi kendine enerji durumunu değiştirememesi potansiyel enerjisinin min. olmasını gerektirir (d'Alembert prensibi)
- Elektronlar mevcut seviyelere Pauli ilkesine göre dağılır.
- Son elektron olabilecek en yüksek enerji seviyesine oturur. Bu enerji **Fermi Enerjisidir (E_F).**



1- YI deki iletkenlik ve valans bantlarındaki izinli enerji seviyelerinin sayısı (Durum yoğunluğu fonksiyonu ve N(E) durum yoğunluğu)

2- Bu iki banttaki seviyelere dağılacak toplam elektron sayısı (Valans bandındaki izinli durumların toplam sayısına eşittir.)

3-Bu elektronların enerji seviyelerine nasıl dağılacağı (Fermi Dirac dağılım Fonk f(E))

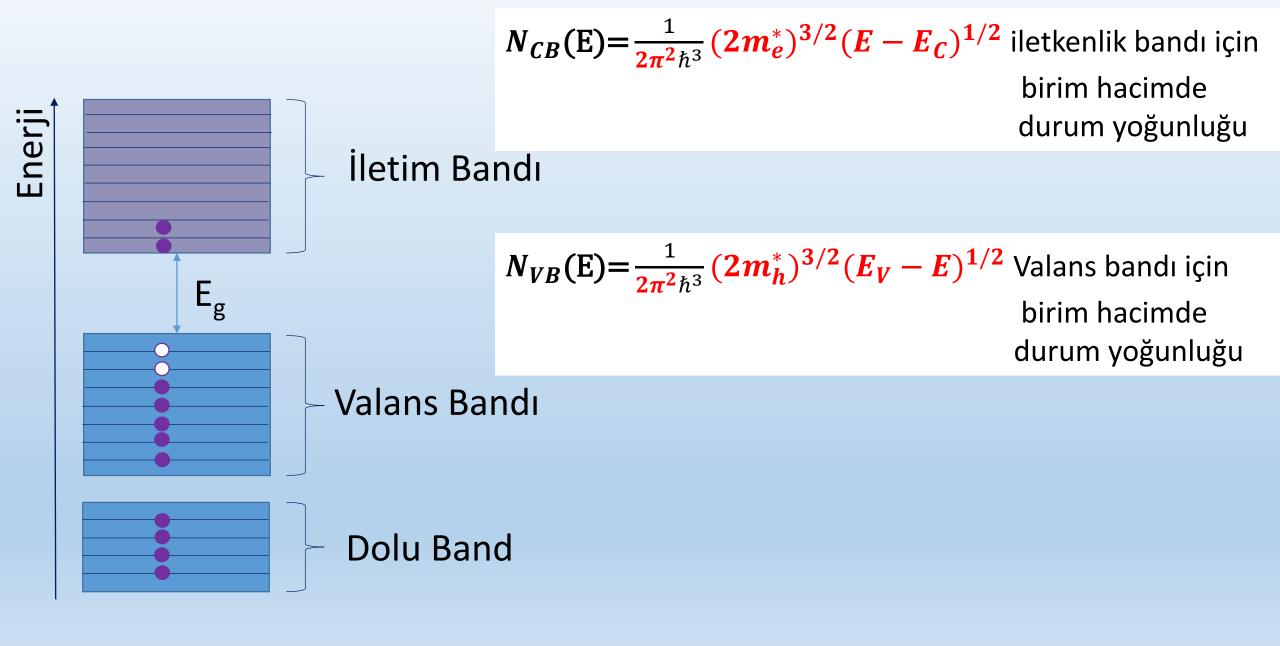
Bir enerji bandı içinde izinli kuantize enerji seviyelerinin dağılımını, durum yoğunluğu fonksiyonu N(E) (veya g(E)) verir.

- * Durum yoğunluğu enerjiye bağlı bir fonk., bellirli bir E enerjisi civarında, sonsuz küçük bir enerji aralığında (dE) izinli durum sayısını verir.
- * Şekildeki dE aralığındaki toplam enerji seviyesi:

$$dN=N(E)dE$$

E1 ve E2 enerji aralığında bulunan N tane izinli enerji durumu;

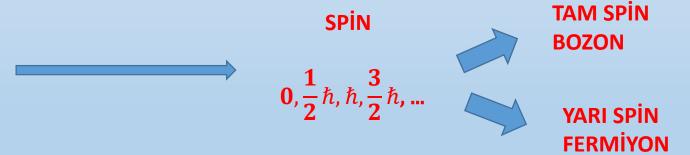
$$N = \int_{E_1}^{E_2} N(E) dE$$



N(E) ⇒ Durum Yoğunluğu Fonksiyonu: Elektronların izinli durumları ile ilgili

<u>Kuantum istatistiği kullanarak elektronların</u> <u>bu izinli durumlara nasıl dağıldığına bakalım</u>

Kuantum mekaniğine göre parçacıklar açısal momentuma sahiptirler



Termodinamikte denge durumunda sistem dağılım fonksiyonu ile tanımlanır



Dağılım fonksiyonu herhangi bir enerji durumunun işgal olasılığını belirler.



Bu olasılığı belirlemek için sistemin serbest enerjisi minimum olmalıdır.

Fermiyon olan elektronların izinli durumlara dağılım fonksiyonu Fermi-Dirac Dağılım Fonksiyonu ile tanımlıdır.

> Belirli bir E enerjisi için f(E): İzinli E enerjili seviyenin belirli bir sıcaklıkta bir elektron tarafından işgal edilme olasılığıdır.

f(E): 1 ile 0 arasında değerler alır.

Fermi-Dirac Dağılım Fonksiyonu, f(E)
Belirli bir sıcaklıkta YI Valans ve iletim
bandlarındaki elektronların denge durumu
dağılımını enerjinin fonksiyonu olarak tanımlar.

izinli E enerjili seviyesi bir elektron tarafından işgal edilmiş, f(E)=0 izinli E enerjili seviyesi bir elektron tarafından işgal edilmemiş işgal olma olasılığı f(E) ise edilmeme olasılığı 1-f(E) olmalıdır.

FERMI-DIRAC DAĞILIM FONKSİYONU,

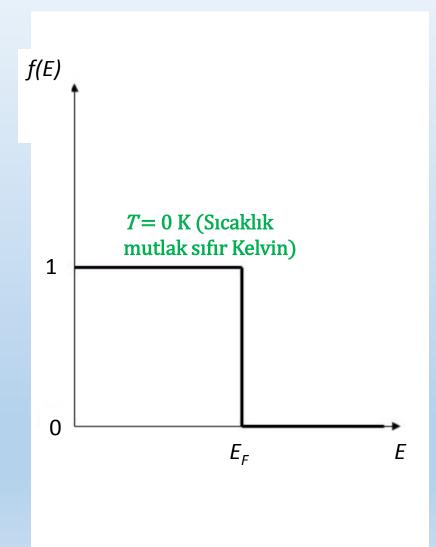
$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_BT}}$$

 k_B : Boltzman Sabiti; 1. $38 \times 10^{-23} J/K$ T: Sıcaklık

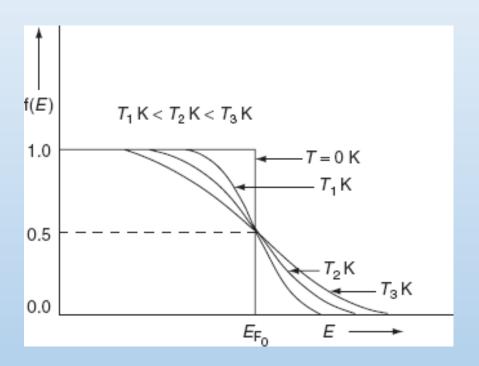
$$T = 0$$
 K için; $E_F = \mu$: Kimyasal potansiyel

$$T = 0 \text{ K ve } E > E_F \text{ ise } f(E) = \frac{1}{1 + e^{(+\infty)}} = 0$$

$$T = 0 \text{ K ve } E < E_F \text{ ise } f(E) = \frac{1}{1 + e^{(-\infty)}} = 1$$



SONLU SICAKLIKLARDA ELEKTRON DAĞILIMI; T > 0 K



$$f(E,T) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{k_B T}}}$$

$$i) E = E_F \Rightarrow f(E,T) = \frac{1}{2}$$

 $m{ii)}~E=E_F\Rightarrow f(E,T)=rac{1}{2}$ $m{ii)}~E-E_F\gg k_BT\Rightarrow f(E,T)=e^{-rac{E-E_F}{k_BT}}$, paydadaki 1 ihmal edilir.

$$=e^{rac{E_F}{k_BT}}e^{-rac{E}{k_BT}}$$
 $=Ae^{-rac{E}{k_BT}}$ Boltzman Dağılımı

 $iii)~E-E_F \ll k_B T \Rightarrow f(E,T)=1$, Boltzman dağlımına göre

iv) elektronlarla dolu olma olasılığı $\Rightarrow f_n(E,T)$

Boş olma olasılığı

$$\Rightarrow f_p(E,T) = 1 - f_n(E,T) \Rightarrow f_p(E,T) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E_F - E}{k_B T}}}$$

Valans Ve iletim bandındaki taşıyıcı yoğunlukları;

Bir YI birim hacminde, E1 ve E2 enerjili durumlar arasına dağılmış elektronların toplam sayısı:

$$n(E_1, E_2) = \int_{E_1}^{E_2} N(E) f(E) dE$$

Mutlak sıfırda iletkenlik bandında bulunan elektron yoğunluğu;

$$N(E) = g(E)$$

$$n_{CB} = \int_{E_C}^{\infty} N_{CB} (E) f(E) dE = 0$$

Mutlak sıfırda valans bandında bulunan elektron yoğunluğu;

$$n_{VB} = \int_{-\infty}^{E_V} N_{VB}(E) f(E) dE = n_{VB} = \int_{-\infty}^{E_V} N_{VB}(E) [1 - f(E)] dE$$

Mutlak sıfırda valans bandında bulunan serbest boşluk yoğunluğu;

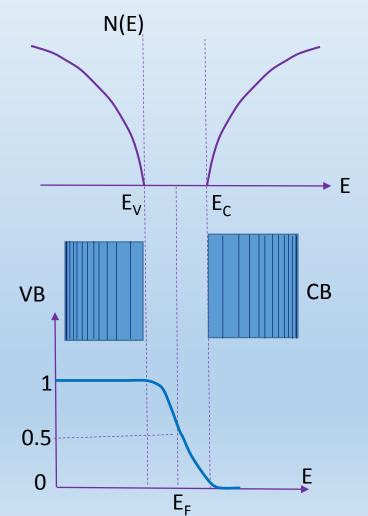
$$p_{VB} = \int_{-\infty}^{E_V} N_{VB} (E) [1 - f(E)] dE = 0$$

ASAL YARIİLETKENDE E, DEĞERİ

ASAL YARIİLETKENLERDE SERBEST YÜK TAŞIYICILARI:

Yarıiletken içindeki serbest yük taşıyıcı yoğunluğunu belirleyeceğiz.

Sonlu sıcaklıkta elektronun serbest bulunduğu seviyeler iletim bandı içindedir. $(Ec-E_F)$?



Yarıiletkenlerin E_g yasak band genişliği~1eV Oda sıcaklığında $k_BT=26\mathrm{meV}$

$$E - E_F \gg k_B T$$

Bu şart sağlandığında FERMİ DİRAC

$$f(E) = \frac{1}{1 + \rho(E - E_F)/k_B T}$$

$$f(E) = e^{-(E-E_F)/k_BT}$$

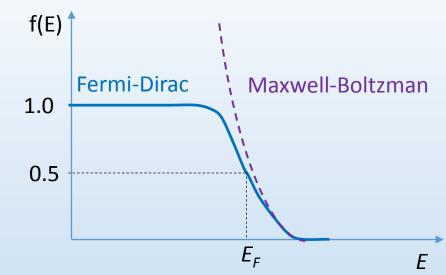
Maxwell-Boltzmann Dağılımına Dönüşür.

ASAL YARIİLETKENLERDE SERBEST YÜK TAŞIYICILARI:

iletim bandında elektron dağılımı; $f(E) = e^{-(E-E_F)/k_BT}$

Bu Maxwell-Boltzmann Dağılımı;

- Klasik parçacıklar için geçerlidir.
- Pauli Dışarlama ilkesi geçersizdir
- Bütün parçacıklar ayırdedilebilir ve aynı izinli durumu işgal edebilir.
- Parçacıklar en düşük enerji seviyesinde yer alır.
- Enerji arttıkça seviyelerin işgal olasılığı hızla azalır.
- Belli bir enerji aralığındaki durumların sayısı sonsuzdur.



Maxwell-Boltzman
dağılımını fermiyonlar için
kullanıyoruz, çünkü iletim
bandında çok sayıda
enerji seviyesi var
bunların çok küçük
bir kısmı elektronlarca
işgal edilebilir.

$$n_{CB} = \int_{E_C}^{\infty} N_{CB}(E) f(E) dE$$

$$f(E) = e^{-(E-E_F)/k_BT}$$

$$N_{CB}(E) = \frac{1}{2\pi^2\hbar^3} (2m_e^*)^{3/2} (E - E_c)^{1/2}$$

$$n_{i} = \int_{E_{C}}^{\infty} \frac{1}{2\pi^{2}\hbar^{3}} (2m_{e}^{*})^{3/2} (E - E_{c})^{1/2} e^{-(E - E_{F})/k_{B}T}) dE \text{ ise,} \quad n_{i} = 2\left(\frac{2\pi m_{e}^{*} k_{B}T}{h^{2}}\right)^{\frac{3}{2}} exp\left(-\frac{E_{C} - E_{F}}{k_{B}T}\right)^{\frac{3}{2}} exp\left(-\frac{E_{C} - E_{F}}{k_{$$

 $N_C=2\left(rac{2\pi m_e^*k_BT}{h^2}
ight)^{(rac{3}{2})}$ iletkenlik bandındaki etkin seviye yoğunluğu

$$n_{i} = 2\left(\frac{2\pi m_{e}^{*}k_{B}T}{h^{2}}\right)^{\left(\frac{3}{2}\right)} exp\left(-\frac{E_{C}-E_{F}}{k_{B}T}\right)$$

ASAL YARIİLETKENDE SERBEST ELEKTRON YOĞUNLUĞU

$$n_i = N_C exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right)$$

$$p_{VB} = \int_{-\infty}^{E_V} N_{VB} (E) [1 - f(E)] dE$$

$$N_V = 2 \left(\frac{2\pi m_h^* k_B T}{h^2}\right)^{(\frac{3}{2})}$$

$$VALANS BANDINDA$$

$$ETKIN SEVIYE YOĞUNLUĞU$$

$$p_i = \left(2 \left(\frac{2\pi m_h^* k_B T}{h^2}\right)^{(\frac{3}{2})}\right) exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right)$$

ASAL YARIİLETKENDE BOŞLUK YOĞUNLUĞU
$$egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} egin{aligned$$

$$n_i = p_i = \sqrt{n_i p_i}$$
 Yük Nötralitesi

$$n_{i}^{2} = n_{i}p_{i} = N_{C}N_{V}exp\left(-\frac{E_{C}-E_{F}}{k_{B}T}\right)exp\left(-\frac{E_{F}-E_{V}}{k_{B}T}\right)$$

$$n_{i}^{2} = n_{i}p_{i} = N_{C}N_{V}exp\left(-\frac{E_{C}-E_{F}}{k_{B}T} - \frac{E_{F}-E_{V}}{k_{B}T}\right), E_{F}'ler gider$$

$$n_{i}^{2} = n_{i}p_{i} = N_{C}N_{V}exp\left(-\frac{E_{C}-E_{V}}{k_{B}T}\right)$$

$$E_{g} = E_{C} - E_{V}$$

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

$$n_i = N_C exp\left(-rac{E_C - E_F}{k_B T}
ight)$$
 ASAL YARIİLETKENDE SERBEST ELEKTRON YOĞUNLUĞU

$$p_i = N_V exp\left(-rac{E_F - E_V}{k_B T}
ight)$$
 ASAL YARIİLETKENDE SERBEST BOŞLUK YOĞUNLUĞU

$$E_g = E_C - E_V \qquad n_i = p_i$$

Etkin durum yoğunluğu ve etkin kütle değerleri

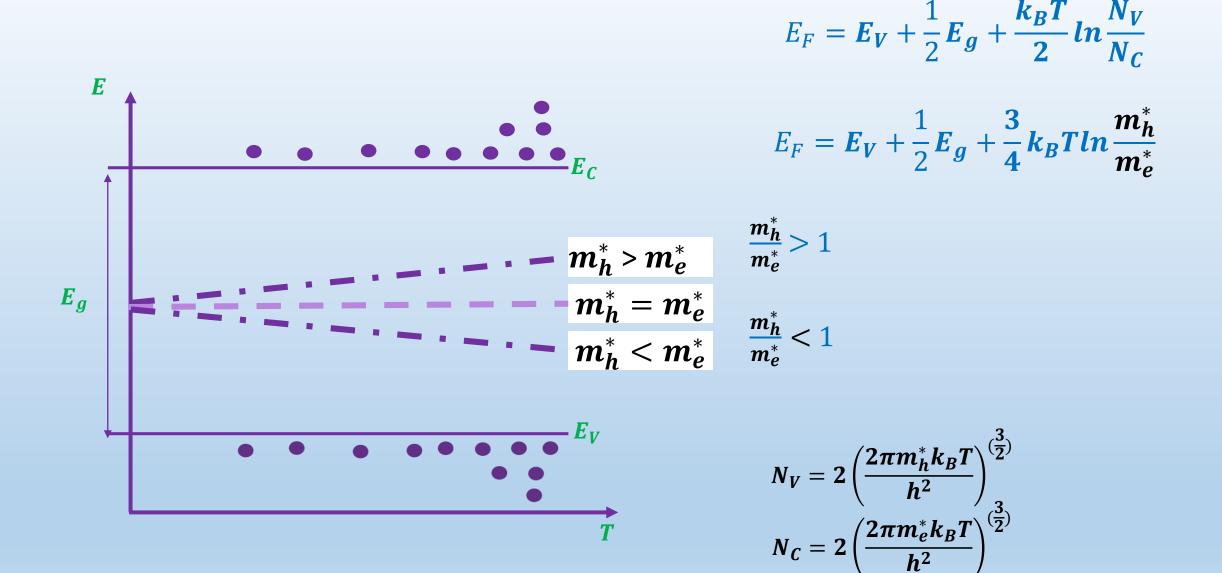
	N_c (cm ⁻³)	N_v (cm ⁻³)	m_n^*/m_0	m_p^*/m_0
Silicon Gallium arsenide Germanium	2.8×10^{19} 4.7×10^{17} 1.04×10^{19}	1.04×10^{19} 7.0×10^{18} 6.0×10^{18}	1.08 0.067 0.55	0.56 0.48 0.37

300 K de n, değerleri

cm^{-3}
cm^{-3}
cm^{-3}

Fermi enerji (E_F) seviyesinin yeri

$$\begin{split} & n_i = N_C exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right) = p_i = N_V exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right) \text{ ise } \frac{N_V}{N_C} = exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right) exp\left(\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right), \text{ buradan} \\ & \frac{N_V}{N_C} = exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T} + \frac{E_F - E_V}{k_B T}\right) \text{ olur. Her iki tarafın } In'i \text{ alınırsa} \\ & ln\frac{N_V}{N_C} = -\frac{E_C - E_F}{k_B T} + \frac{E_F - E_V}{k_B T} \\ & ln\frac{N_V}{N_C} = -(E_C + E_V)/k_B T + 2E_F/k_B T \\ & 2E_F = (E_C + E_V) + k_B T ln\frac{N_V}{N_C} \\ & E_F = \frac{1}{2}(E_C + E_V) + \frac{1}{2}k_B T ln\frac{N_V}{N_C} \text{ veya } E_F = E_V + \frac{1}{2}E_g + \frac{1}{2}k_B T ln\frac{N_V}{N_C}, \quad E_F = \frac{1}{2}(E_C + E_V) \text{ veya } E_F = E_V + \frac{1}{2}E_g \text{ olur.} \\ & N_V = 2\left(\frac{2\pi m_h^* k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{(2)}} \\ & E_F = \frac{1}{2}(E_C + E_V) + \frac{3}{4}k_B T ln\frac{m_h^*}{m_e^*} \text{ veya } E_F = E_V + \frac{1}{2}E_g + \frac{3}{4}k_B T ln\frac{m_h^*}{m_e^*} \end{split}$$



ASAL YARIİLETKENLERDE TAŞIYICI YOĞUNLUĞUNUN SICAKLIĞA BAĞLILIĞI;

$$N_C = 2\left(\frac{2\pi m_e^* k_B T}{h^2}\right)^{\left(\frac{3}{2}\right)}$$

$$n_{i} = 2 \left(\frac{2\pi m_{e}^{*} k_{B} T}{h^{2}} \right)^{\left(\frac{3}{2}\right)} 2 \left(\frac{2\pi m_{h}^{*} k_{B} T}{h^{2}} \right)^{\left(\frac{3}{2}\right)} exp\left(-\frac{E_{g}}{2k_{B} T} \right)$$

$$N_V = 2\left(\frac{2\pi m_h^* k_B T}{h^2}\right)^{\left(\frac{3}{2}\right)}$$

$$N_{V} = 2\left(\frac{2\pi m_{h}^{*}k_{B}T}{h^{2}}\right)^{(\frac{3}{2})} \qquad n_{i} = 2\left(\frac{2\pi m_{e}^{*}k_{B}T}{h^{2}}\right)^{(\frac{3}{2})} 2\left(\frac{2\pi m_{h}^{*}k_{B}T}{h^{2}}\right)^{(\frac{3}{2})} exp\left(-\frac{E_{g}}{2k_{B}T}\right)^{(\frac{3}{2})}$$

$$n_i = \sqrt{N_C N_V} exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

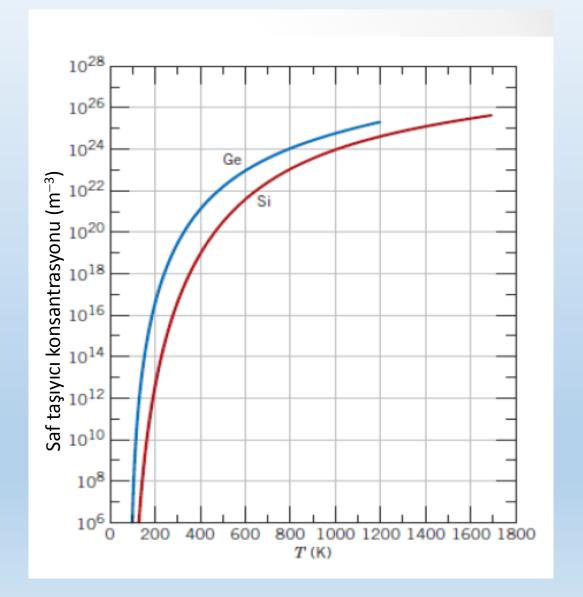
A, Malzemeye özgü bir sbt

$$n_i = p_i = 2\left(\frac{2\pi k_B \sqrt{m_e^* m_h^*}}{h^2}\right) T^{\left(\frac{3}{2}\right)} exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \qquad n_i = p_i = AT^{\left(\frac{3}{2}\right)} exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

ASAL YARIİLETKENLERDE TAŞIYICI YOĞUNLUĞUNUN SICAKLIĞA BAĞLILIĞI;

$$n_i = p_i = AT^{\left(\frac{3}{2}\right)} exp\left(-\frac{E_g}{2k_BT}\right)$$

A: Malzemeye bağlı bir sabit (C ve B ile de gösteriliyor)



Oda sıcaklığında Si'nin saf taşıyıcı konsantrasyonu 10¹⁶ m ³'tür ve bu değer malzemenin bant aralığı ile orantılıdır. Bu değer $3 \times 10^{-4} (\Omega \text{ m})^{-1}$ iletkenlik demektir. Bu değer cihaz yapımı için uygun bir değer değildir.

İletkenliği artırmak için yarıiletken değiştirilebilir mesela Germanyum (Ge) gibi daha düşük bant aralığına sahip malzeme kullanılabilir.

Ancak malzeme değiştirilemezse, taşıyıcı konsantrasyonunu arttırmanın bir yolu da sıcaklığı arttırmak gibi gözüküyor, fakat bu uygun bir yöntem değildir, çünkü sıcaklık değiştiğinde iletkenlik de değişeceğinden cihazın çalışma kararlılığı bozulacaktır.

İletkenliği artırmanın en yaygın yolu, katkılamadır; uygun safsızlık atomlarının bir asal yarı iletkene eklenmesiyle kontrol edilebilir olarak taşıyıcı konsantrasyonunu artırmaktır. Buna katkılı yarıiletken denir.

Dengedeki herhangi bir yarıiletkende, kütle etkisi yasası karşılanmalıdır,

Asal YARIİLETKEN

$$n_i = p_i$$

Kütle etkisi Yasası
$$oldsymbol{n_i}.oldsymbol{p_i}=oldsymbol{n_i}^2=oldsymbol{p_i}^2$$

Katkılı YARIİLETKEN

$$n \neq p$$

Kütle etkisi Yasası

$$n.p = n_i^2$$

p_i: : Asal yarıiletkende valans bandındaki boşluk konsantrasyonu (1/m³)

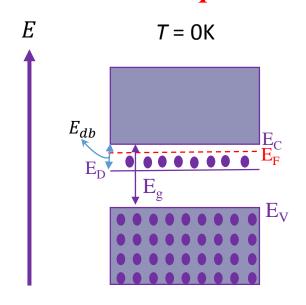
n_i: : Asal yarıiletkende iletim bandındaki serbest elektron konsantrasyonu (1/m³)

p: : Katkılı yarıiletkende valans bandındaki boşluk konsantrasyonu (1/m³)

n: : Katkılı yarıiletkende iletim bandındaki serbest elektron konsantrasyonu (1/m³)

n-tipi Yarıiletkenler

KATKILI (EXTRINSIC) YARIİLETKENLER





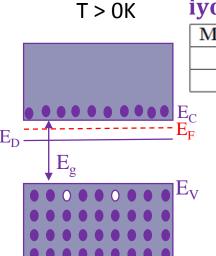
$$n = n_i + N_D$$

 N_D : n tipi katkılı yarıiletkende Donör atom konsantrasyonu $(1/m^3)$

$$N_D \gg n_i \rightarrow n = N_D$$

$$p = \frac{n_i^2}{N_D} \ll N_D$$

 $\sigma \approx N_D e \mu_n$



iyonizasyon enerji (meV)

Material	P	As	Sb
Si	45	54	39
Ge	12	12.7	9.6

$$E_{Hidrojen} = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_o^2 h^2} = -13.6 \text{ eV}$$

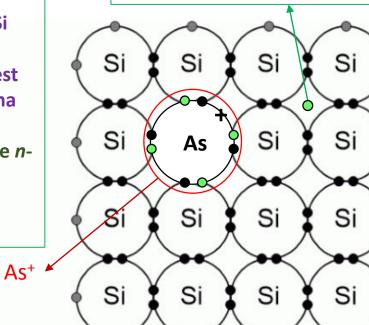
$$E_D = E_C \left(13.6 \frac{m_e^*}{m_o} \left(\frac{\varepsilon_o}{\varepsilon} \right)^2 \right) \quad eV$$

5. Elektron sadece As atomuna bağlı ve küçük bir enerji ile serbest hale geçer yani E_D enerji seviyesi E_C ye yakın

 E_{db}

Çok küçük ısı enerjisi (oda ısısı yeterli olabilir) ile As iyonlaşır ve kristale ekstra serbest elektron verilir.

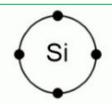
olmalı.



• 5. Grup elementleri

P, Sb ve As gibi beş valans elektronlu safsızlıklar Si kristaline katkılanırsa (yani bir silisyum atomunu öteleyip yerine geçme) kristale fazladan bir serbest elektron verirler. Bu yüzden bu safsızlık atomlarına donör (VERİCİ) atomları denir.

- Bu safsızlıklarla katkılanarak üretilmiş yarıiletkene *n*tipi yarıiletken denir.
- Çoğunluk yük taşıyıcıları elektronlardır.
- Azınlık yük taşıyıcıları boşluklardır.

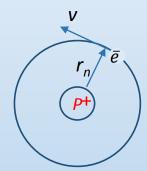


As

Iyonlaşma Enerjileri

Donör elektronun donör safsızlık iyonundan yaklaşık uzaklığını ve ayrıca donör elektronun iletkenlik bandına yükselmesi için gerekli enerjiyi yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. Bu enerji iyonlaşma enerjisi olarak atfedilir. Bu hesaplamalar için Bohr atom modelini kullanacağız. Çünkü kuantum mekaniğinden belirlenen, hidrojen atomunda elektronun çekirdekten en muhtemel uzaklığı Bohr yarıçapı ile aynıdır. Kuantum mekaniğinden belirlenen hidrojen atomundaki enerji seviyeleri de Bohr teorisi ile elde edilenle aynıdır.

Donör safsızlık atomu durumunda, donör elektronunu, yarıiletken malzeme içerisinde gömülü, donör iyonunun etrafında yörüngeleniyor olarak görselleştirebiliriz. Donör elektronu için hesaplamalarda, hidrojen atomunda kullanılan serbest uzay (vakum) elektrik geçirgenliği (ε₀) yerine yarıiletken malzemenin elektrik geçirgenliği (ϵ) kullanılır. $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$, burada bağıl dielektrik sabitidir, yani malzemenin elektrik geçirgenliğinin vakumun (boşluk) geçirgenliğine oranıdır. $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m.



$$F_M=F_E, \text{dolayısıyla } \frac{m_0v^2}{r_n}=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0r_n^2}$$
 Açısal momentum kuantizedir, $L=m_0vr_n=n\hbar,\,\hbar=\frac{h}{2\pi}$

Kuantize eşitliğinden v çekilip yukarıdaki eşitlikte yerine konursa, $r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0 n^2\hbar^2}{m^2 \epsilon^2}$

Hidrojen atomu

Bu denklemde n = 1, $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} F/m$, $\hbar = 1.054 \times 10^{-34} J.s$, $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} kg$, $e = 1.6 \times 10^{-19} C$ değerleri yerine konursa, $r_1 = 0.53 \, A^{\circ} = a_0$, Bohr yarıçapı bulunmuş olur.

$$m_0 v^2 = \frac{e^2}{4\pi \varepsilon_0 r_n}$$
 yazılırsa, toplam enerji, yani elektronun hidrojen atomuna bağlanma enerjisi,

$$E = K + V = \frac{1}{2}m_0v^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0r_n} = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0r_n} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0r_n} = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0r_n}$$

Burada yukarıda bulunan r_n yerine yazılırsa, $E_H=-rac{m_0e^2}{32\pi^2\varepsilon_0^2n^2\hbar^2}$ bulunur ve yukardaki değerler yerine konursa n=1 için $E_H=-2.17x10^{-18}J\equiv -13.6eV$ bulunur, elektronun hidrojen atomuna bağlanma enerjisi.

Silikon kristaline katkılanmış Donör Arsenik atomu

İyonlaşma Enerjileri

Bu denklemi yarıiletken içerisinde iyonize donör atomuna uyarlarsak, elektronun serbest kütlesi yerine etkin kütle, ε_0 yerine de yarıiletkenin elektrik geçirgenliğini (ε) alacağız. Kristal katı içerisinde donör iyonlaşma enerjisi ve iyonik yarıçapı sırasıyla aşağıdaki gibi olur.

$$E_{db}=-rac{m^*e^2}{32\pi^2 arepsilon^2 \hbar^2}$$
 donör elektronun iyonuna bağlanma enerjisi (iyonlaşma enerjisi)

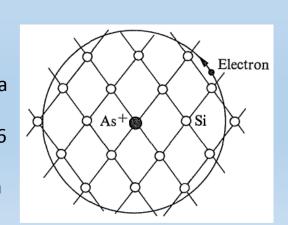
$$r_d=rac{4\pi arepsilon n^2\hbar^2}{m^*e^2}$$
 donör elektronunun iyonlaşma yarıçapı, n = 1 için Hidrojen atomunkilerle bunları oranlarsak,

$$\frac{E_{db}}{E_H} = \frac{-\frac{m^*e^2}{32\pi^2\varepsilon^2n^2\hbar^2}}{-\frac{m_0e^2}{32\pi^2\varepsilon_0^2n^2\hbar^2}} = \left(\frac{m^*}{m_0}\right)\left(\frac{\varepsilon_0^2}{\varepsilon^2}\right) = \left(\frac{m^*}{m_0}\right)\left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\right)^2 = \left(\frac{m^*}{m_0}\right)\left(\frac{1}{\varepsilon_r^2}\right)$$

$$n$$
 = 1 için $E_H=-13.6eV$ yazılırsa $E_{db}=-13.6\left(rac{m^*}{m_0}
ight)\left(rac{1}{arepsilon_r^2}
ight)\,eV$, $r_d=a_0arepsilon_r\left(rac{m_0}{m^*}
ight)$ dir.

Silikon içinde donör için iletkenlik etkin kütle oranını $\frac{m^*}{m_0}=0.26\,$ alırsak,

silikon için $\varepsilon_{\rm r}=11.7$ dir. Bu durumda $r_d=45a_0=23$ A° olur. Bu da silikonun örgü sabitinin ($a_{\rm Si}=5.43$ A°, $a_{\rm Ge}=5.66$ A°) dört katına karşılık gelir. Silikonun birim hücresinde etkin olarak sekiz atom vardır, dolayısıyla yörüngelenen donör elektronun yarıçapı çok sayıda silikon atomunu kapsar. Aynı değerler içinde $E_{db}=-25.8meV$ bulunur. 300 K de $k_{\rm B}T=26$ meV. Bu değer silikonun bant gap enerjisinden çok daha küçüktür. Bu enerji donör elektronunun iletkenlik bandına yükselmesi için gerekli olan yaklaşık iyonlaşma enerjisidir. Donör elektronu donör atomuna sıkı bağlı değildir. Benzer şekilde akseptör iyonlaşma enerjisi de bulunur.

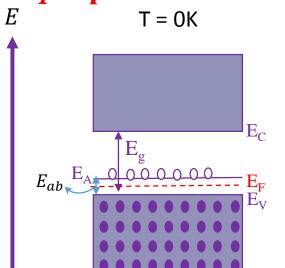


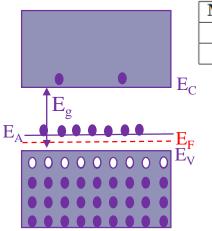
	İyonlaşma enerjisi (eV)		
	Si $(\varepsilon_r = 11)$	Ge (ε_r = 16)	
Donörler			
Fosfor (P)	0.044	0.012	
Arsenik (As)	0.049	0.0127	
Antimon (Sb)	0.039	0.096	
Akseptörler			
Bor (B)	0.045	0.0104	
Alüminyum	0.06	0.0102	
(AI)			
Galyum (Ga)	0.065	0.011	
Indiyum (In)	0.16	0.011	

	İyonlaşma enerjisi (eV)
	GaAs (ε_r = 12.9)
Donörler	
Selenyum	0.0059
Telliryum	0.0058
Silikon	0.0058
Germanyum	0.0061
Akseptörler	
Berilyum	0.028
Çinko	0.0307
Kadmiyum	0.0347
Silikon	0.0345
Gemanyum	0.0404

p-tipi Yarıiletkenler

KATKILI (EXTRINSIC) YARIİLETKENLER





T > 0K

Material	В	Al	Ga	In
Si	45	57	65	157
Ge	10.4	10.2	10.8	11.2

iyonizasyon enerji (meV)

$$E_{Hidrojen} = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_o^2 h^2} = -13.6 \text{ eV}$$

$$E_A = E_V + \left(13.6 \frac{m_e^*}{m_o} \left(\frac{\varepsilon_o}{\varepsilon}\right)^2\right) \text{ eV}$$

$$E_{ab}$$

B atomunun yerleştiği yerde, bağın birinde bir elektron yeri eksik kalır.

Bu eksiklik küçük bir enerji ile valance band elektronu ile doldurulur, böylece valans banttan gelen elektronun yeri boş kalır. E_A enerji seviyesi E_V ye yakın olmalı.

• Elektron ○ Boşluk

$$p = p_i + N_A$$

 N_A : p tipi katkılı yarıiletkende Akseptör atom konsantrasyonu $(1/m^3)$

$$N_A \gg n_i \rightarrow p = N_A$$

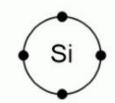
$$n = \frac{n_i^2}{N_A} \ll N_A \quad \sigma \approx N_A e \mu_p$$

• 3. Grup elementleri

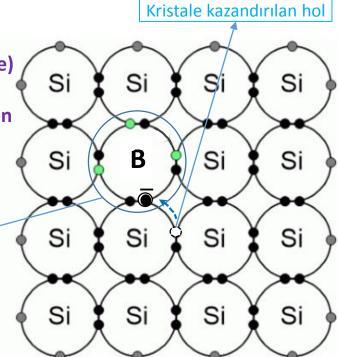
B, Ga ve Al gibi üç değerlikli safsızlıklar Si kristaline katkılanırsa (yani bir silisyum atomunu öteleyip yerine geçme) kristale fazladan bir hol kazandırırlar (komşu silikonun bir elektronunu kendi bağını tamamlamak için alarak). Bu yüzden bu safsızlık atomlarına akseptör (ALICI) atomları denir.

• Bu safsızlıklarla katkılanarak üretilmiş yarıiletkene *p*-tipi yarıiletken denir.

- Çoğunluk yük taşıyıcıları boşluklardır.
- Azınlık yük taşıyıcıları elektronlardır.







KATKILI YARIİLETKENLERDE FERMİ SEVİYESİNİN YERİ

n- tipi YARIİLETKENLERDE FERMİ SEVİYESİNİN YERİ

$$n = N_C exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right)$$

$$E_F = E_C + k_B T \ln(\frac{n}{N_C})$$

p- tipi YARIİLETKENLERDE FERMİ SEVİYESİNİN YERİ

$$p = N_V exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right)$$

$$E_F = E_V - k_B T \ln(\frac{p}{N_V})$$

Kompense Yarıiletkenler

- Aynı bölgede hem donör hemde akseptör safsızlık atomları içeren yarıiletken malzemelere denir.
- *n*-tipi malzemeye akseptör atomları katkılayarak veya *p*-tipi malzemye donör atomları katkılayarak elde edilirler.
- Elektronik cihazlarda eklem oluşturulması gerektiğinde kullanılır.
- Bir *pn* eklem oluşturmak için, *n* katkılı bir numune seçilir ve daha sonra *p*-tipi katkı maddesi ile katkılanır veya bunun tersi de geçerlidir.
- Bir yarı iletkende hem donörler hem de alıcılar varsa, o zaman daha yüksek konsantrasyona sahip olan baskın olacak ve böylece nihai malzeme *n* veya *p* tipi olacaktır.

$$N_A \ ve \ N_D \gg n_i \quad ve \quad N_D > N_A \Longrightarrow n \ tipi$$

 $N_A \ ve \ N_D \gg n_i \quad ve \quad N_A > N_D \Longrightarrow p \ tipi$

 $N_A = N_D$ ise tamamen kompense yarıiletken olur ve intrinsic malzeme karakteri gösterir.

TAŞIYICILARIN DENGELENMESİ (COMPENSATION)

Yarıiletken malzemeyi n tipinden p tipine dönüştürmek için hollerin sayısını elektronların sayısından daha fazla yapacak şekilde katkılama yapılır, benzer şekilde p-tipini n-tipi yapmak için de serbest elektronların sayısını daha fazla yapacak şekilde katkılanır. Böylece bir malzemede katkılamayla tip değişimi yapılabileceği gibi, aynı malzemede istenen oranda taşıcı konsantrasyonuna sahip farklı tipte bölgeler oluşturulabilir. Bu durumda yarıiletken hem n-tipine ait donör atomları hem de p-tipine ait akseptör atomları içerir. Bu durum için yük nötralitesi: $n + N_A^- = p + N_D^+$, yani, kristal yapıya safsızlık atomları katkılandığında, toplam negatif yük (elektronlar ve iyonize akseptörler) toplam pozitif yüke (holler ve ionize donörler) eşit olmalıdır.

Termal dengede yarıiletken elektriksel olarak nötrdür. Elektronlar değişik enerji durumları arasında dağılırlar, negatif ve pozitif yükler oluştururlar, fakat net yük yoğunluğu sıfırdır. Bu yük nötrlük şartı, termal dengede, safsızlık katkılama konsantrasyonun bir fonksiyonu olarak elektron ve hol konsantrasyonunu belirlemek için kullanılır.

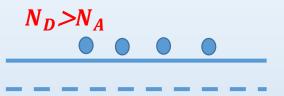
$$n + N_A^- = p + N_D^+$$

Yeterince yüksek sıcaklıklarda tüm katkı atomları iyonlaşabilir, dolayısıyla iyonize safsızlık atomlarının sayısı katkılanan safsızlık atomlarının tamamına eşit olur bu durumda $n+N_A=p+N_B$

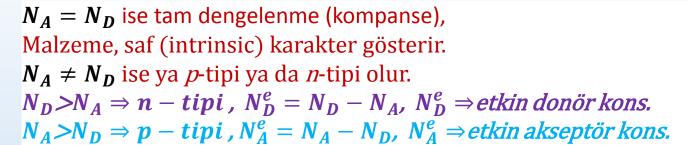
$$n+N_A=p+N_D$$
 $N_D>N_A\Rightarrow p=rac{n_i^2}{n}$, dolayisiyla $n=rac{n_i^2}{n}+N_D-N_A$ olur.
 $n^2-(N_D-N_A)n-n_i^2=0$
 $n=rac{(N_D-N_A)}{2}+\sqrt{\left(rac{N_D-N_A}{2}
ight)^2+n_i^2}$

 $N_D=N_A$ ise $m{n}=m{n_i}$ olur, yani katkılı malzeme, saf (intrinsic) malzeme davranışı gösterir. Benzer bir formül p içinde bulunabilir.

TAŞIYICILARIN KOMPANSESİ



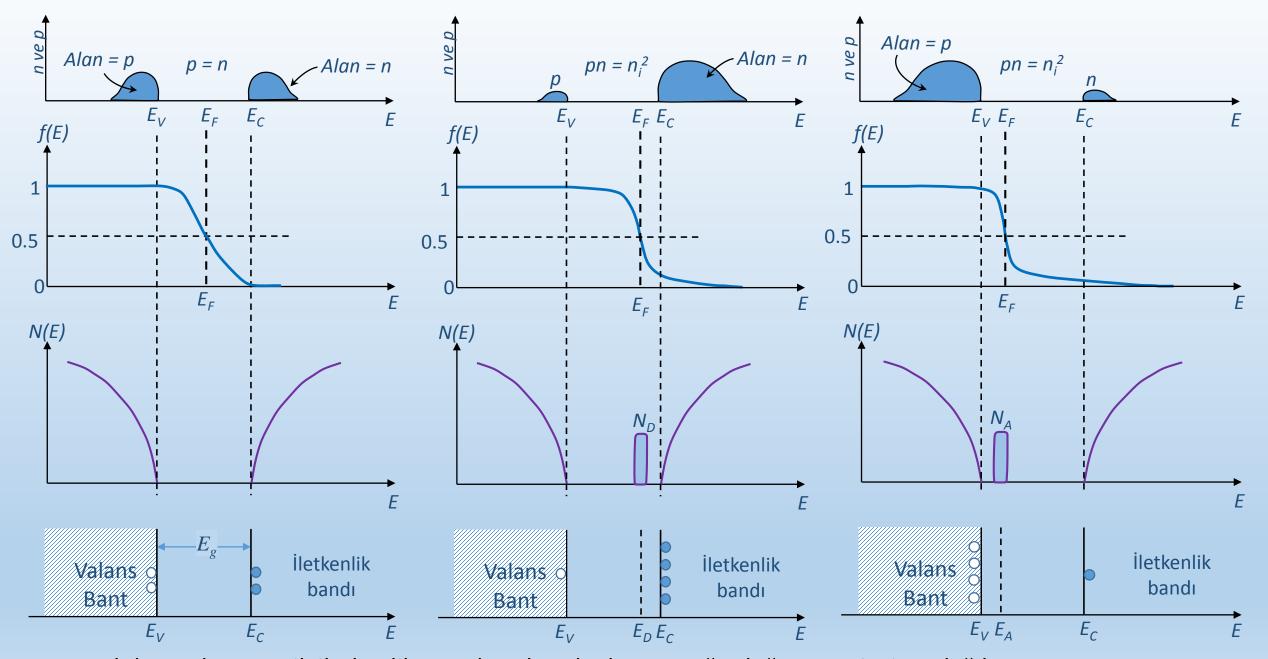
 $N_A > N_D$



Safsızlık katkılandığında, kütle aksiyon yasası $pn = n_i^2$ yine geçerlidir (dejenereliğe kadar). pn çarpımı katkılanan safsızlıklardan daima bağımsızdır. Yapıya donör safsızlıkları eklendiğinde n artarken, aynı oranda p azalacaktır.

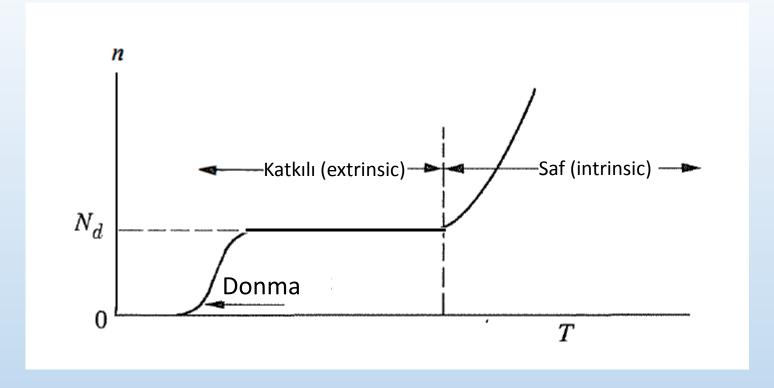
Farklı konsantrasyonlu iki malzeme birbiriyle kontağa getirildiğinde yüksek konsantrasyonlu malzemedeki elektronlar, termal dengeye ulaşana kadar, düşük konsantrasyonlu malzemeye doğru hareket ederler. Enerjinin bir fonksiyonu olarak elektron dağılımı iki malzemede aynı olunca termal denge oluşur. Bu denge durumu her iki malzemede Fermi enerjisi aynı olduğunda oluşur.

Saf silikon kristalinde $5x10^{22}$ atom/cm⁻³ vardır. 10^{15} ile 10^{18} atom/cm⁻³ aralığındaki tipik katkılama oranları yarıiletkenin gerçek atom sayısına ($5x10^{22}$ atom/cm⁻) göre küçüktür. Fosfor arsenik gibi donör safsızlık atomlarının varlığı bant gap ($E_{\rm g}$) içine bir izinli $E_{\rm D}$ seviyesi ekler. Dolayısıyla yarıiletkene bu oranlarda safsızlık katkılaması yarıiletkenin bant gap ($E_{\rm g}$) gibi kendine özgü belirli parametrelerini etkilemez. Eğer katkılama sayısı 10^{20} atom/cm⁻³ gibi çok büyük değerlere çıkarsa izinli $E_{\rm D}$ seviyesi yayılararak genişler, dolayısıyla iletkenlik bandı ile üst üste binen bir izinli banda dejenereleşir (katmerleşir). Netice olarak $E_{\rm g}$ yasak enerji aralığı küçülerek değişir ve yarıiletkenin özellikleri önemli ölçüde değişir. Bu yarıiletkene dejenere yarıiletken denir. Bir dejenere yarıiletken bir metalinkine benzer elektrik özellikleri gösterir.



Termal dengede şematik iletkenlik ve valans bandı, durum yoğunluğu, Fermi-Dirac dağılımı, taşıyıcı konsantrasyonu; (a) Saf (intrinsic) $(n=p=n_i)$ için, (b) n-tipi için, (c) p-tipi yarıiletken için.

Bir *n*-tipi yarıiletkende sıcaklıkla elektron konsantrasyonu *n*'nin değişimi



- Yüksek sıcaklıklarda $n \approx p \approx n_i > N_D$ olduğundan saf (intrinsic) taşıyıcılar baskındır.
- Orta sıcaklıklarda $n \approx N_D$ dir. Katkı taşıyıcıları baskındır. Bu bölgede (extrinsic) elektron yoğunluğu geniş bir sıcaklık aralığında hemen hemen sabit kalır. Örneğin $N_D = 10^{15}$ cm⁻³'e sahip silikon için elektron yoğunluğu 100 K ile 500 K aralığında hemen hemen sabit kalmaktadır.
- Çok düşük sıcaklıklarda safsızlıkların çoğu donar, dolayısıyla elektron yoğunluğuna katkıları oldukça azalır. Ayrıca sıcaklık azaldıkça saf taşıyıcı konsantrasyonu da azalmaktadır. Böylece çok düşük sıcaklıklarda iletkenlik de sıfıra gitmektedir.